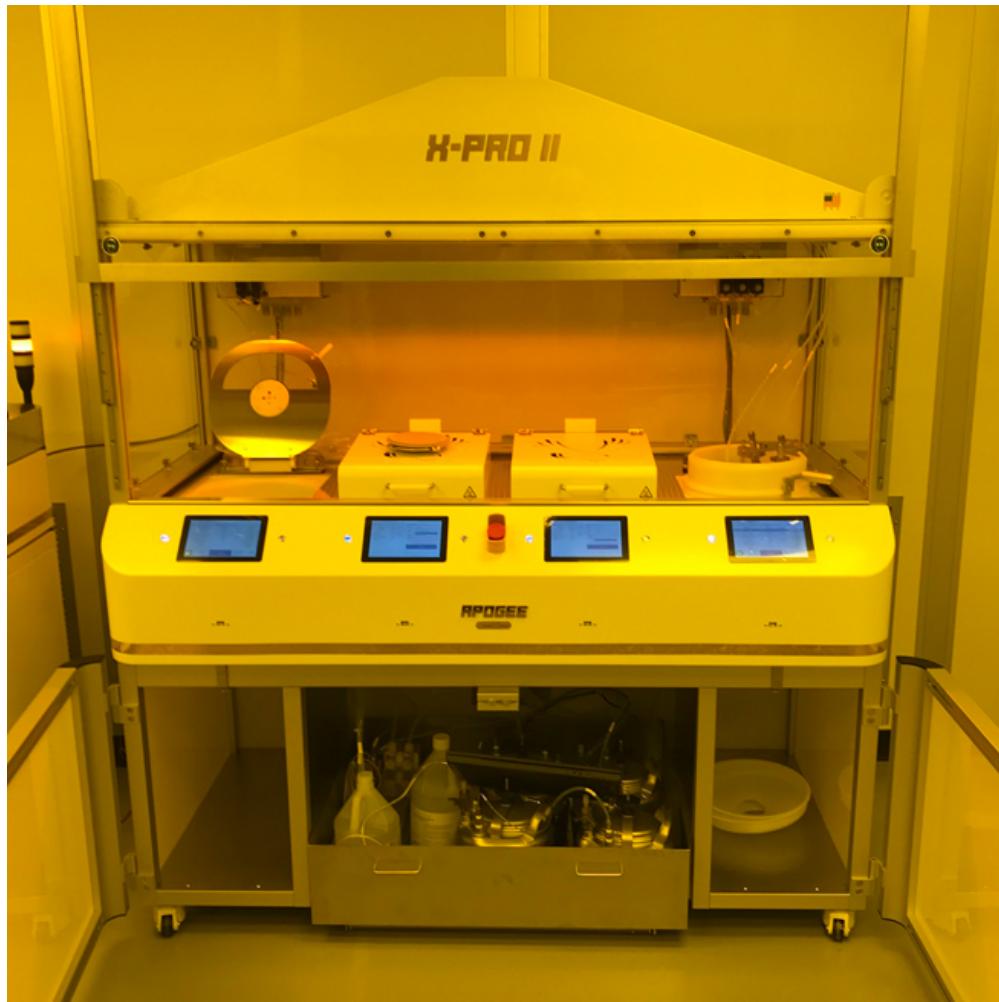


Центрифуга для нанесения фоторезиста Apogee Spin Coater

**Производитель:**

Cost Effective Equipment (CEE)

Цена:

Цена по запросу

Описание

Центрифуга Apogee Spin Coater предназначена для одиночной обработки пластин размером до 200 мм (дополнительно 300 мм) или квадратных подложек с габаритами до 177x177 мм. Химически и коррозионностойкий материал рабочей чаши позволяет использовать все виды химических реагентов. Различные системы подачи фоторезиста в центрифугу, различные варианты держателей подложек, опция отмывки обратной стороны (BSR - back side rinse), опция удаления краевого валика (EBR - edge bead removal), делают центрифугу Apogee Spin Coater универсальным решением практически для любых задач. Управление центрифугой производится при помощи цветного сенсорного дисплея с GUI-интерфейсом. Инновационное программное обеспечение DataStream™ позволяет

осуществлять работу по рецептам и анализировать рабочие параметры в режиме реального времени. Предусмотрены USB и Ethernet порты для экспорта/импорта данных. Конструкция центрифуги Apogee Spin Coater выполнена по принципу «plug&play», тем самым обеспечивается простая инсталляция и легкое освоение для пользователей любого уровня.

Для заказа доступны как настольный вариант размещения, так и встраиваемый вариант для интеграции в рабочий модуль X-Pro II.

Область применения

- Нанесение фоторезиста, полиимида, золь-гель (sol-gel).
- Фотолитография.

Особенности

- Дозирующие насадки для использования 5-ти различных фоторезистов одновременно.
- Ручная или автоматическая подача фоторезиста.
- Быстрая смена подложкодержателя под пластины различного размеры.
- Возможность работы с фоторезистами с низкой и средней вязкостью (до 5000 сP): DUV BARCs, фоторезист JSR M91Y/M230Y, Microposit S1800, AZ 1500 resist, PMMA, AZ 5200.
- Возможность работы с фоторезистами с высокой вязкостью (до 50000 сP): фоторезист MicroChem SU-8, Shipley BPR-100, Futurex NR9, MicroChem LOR, MicroChem PMGI, AZ 4600, AZ 9200, Shin-Etsu MicroSi SIPR 9740, Fujifilm Durimide, полиимиид HD Microsystems 2610-2620.
- Простой интерфейс управления с цветным сенсорным дисплеем 7" и инновационным ПО DataStream™.
- Лидирующий на рынке показатель надежности и времени безотказной работы.

Технические характеристики

Максимальный диаметр подложки	200 мм (опционально 300 мм) Фотошаблоны до 177×177 мм
Скорость вращения Разрешение Воспроизводимость	0 – 12.000 об/мин (регулируется в ПО)
Ускорение скорости вращения	0 – 30.000 (об/мин)/с (без подложки) 0 – 23.000 (об/мин)/с (с пластиной 200 мм)

Тип корпуса	Настольный или встраиваемый
Материал чаши	Химически и коррозионностойкий полиэтилен (HDPE)
Подача фоторезиста	Ручная или автоматическая
Линия подачи фоторезиста	1-5 шт.
Отмывка обратной стороны (BSR)	Имеется для пластин Ø50-200 мм
Удаление краевого валика фоторезиста (EBR)	Имеется для пластин Ø50-200 мм
Управление	<ul style="list-style-type: none"> Цветной сенсорный LCD дисплей 7" Встроенный контроллер с новейшим ПО DataStream™ для отображения параметров процесса в режиме реального времени Интуитивно понятный GUI-интерфейс Работа по рецептам (время шага 0-9999.9 с, разрешение 0.1 с) USB/Ethernet порты для загрузки/выгрузки параметров рецепта Экспорт данных в Excel Встроенные защитные блокировки для безопасной работы
Габариты (Ш×В×Г)	336×483×457 мм
Вес	21 кг
Дополнительные опции	<ul style="list-style-type: none"> Комплект универсальных держателей Съемные вкладыши в чашу Комплект ручных дозаторов Картриджная система подачи реагентов Автоматическая подача реагентов Емкость для сбора реагентов с сенсором уровня заполнения Центрирующий инструмент для пластин Продувка чаши азотом